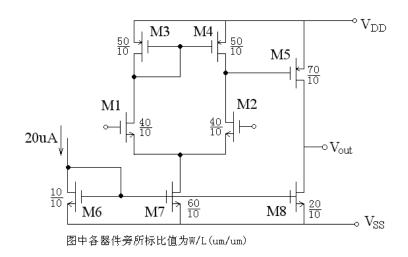
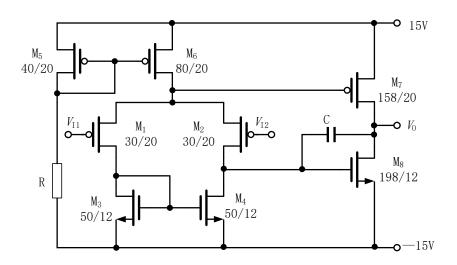
- 1、已知如下图所示运放,其中MOS管器件参数: K_n =25μA/V², K_p =10μA/V², λ_n = λ_p = λ =0.04V-¹, 则:
- (1)、根据图中所示电路结构判断宜选N阱还是P阱工艺实现集成?简述理由。
- (2)、若 V_{DD} =5V, V_{SS} =-5V,求运放的静态功耗 P_{diss} 和小信号电压增益 A_V (忽略输出级产生的负载)。



2、CMOS 运放如下图所示, MOS 管的 W/L 如图中所标。

已知: V_{TP} = -1V, V_{TN} = 1.5V, R = 140k Ω , NMOS 的 k = 6.9 μ A/V², PMOS 的 k = 2.3 μ A/V², 1/ λ = 50V \circ

(1) 分析电路的组成; (2) 计算各管的静态电流。



3、CMOS 运放如下图所示,其中各有关参数为: $\mu_N=400\text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$, $\mu_P=200\text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$, $\lambda=0.01$, $C_{\text{OX}}=2.3\times10^{-8}\text{F/cm}^2$, $V_{\text{TP}}=-1\text{V}$, $V_{\text{TN}}=1\text{V}$ 。 试求各支路电流 I_0 , I_1 , I_2 和电路的总电压放大倍数 $A_{\text{V}}=?$

